(43) 国際公開日

2001年9月20日(20.09.2001) PCT

PCT/JP01/02041

日本語

C07H 15/203, A61K (51) 國際特許分類7: 31/7034, A61P 43/00, 3/10, 3/04, C07C 69/78, 69/16, 69/18, 323/18, 39/15, 43/23

(21) 國際出願番号:

2001年3月15日(15.03.2001) (22) 国際出版日:

(25) 国際出願の言語:

日本部

(26) 国際公別の言語:

(30) 優先権データ: 2000年3月17日(17.03.2000) JF 特顯2000-77304

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): キッセ イ薬品工業株式会社 (KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒399-8710 長野県松本市芳野19番 48号 Nagano (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤倉秀紀 (FU-JIKURA, Hideki) [JP/JP]; 〒390-0851 長野県松本市大 字島内4152-1 モダンティパレス望月101 Nagano (JP). 伏見信彦 (FUSHIMI, Nobuhiko) [JP/JP]; 〒390-0313 長野県松本市岡田下岡田89-6 Nagano (JP). 西村俊津 (NISHIMURA, Toshthiro) [JP/JP]; 〒399-8304 長野県 南安县部稳高町大字柏原4511 Nagano (JP). 田舎和也 (TATAN], Kazuya) [JP/JP]; 〒390-0805 長野県松本市 濟水1-3-5 サンスーシ21-203 Nagano (JP). 勝野健次 (KATSUNO, Kenji) [JP/JP]; 〒399-0601 長野県上伊那郡辰野町大字小野272-1 Nagano (JP). 平橋正博 (HI-RATOCHI, Masahiro) [JP/JP]; 〒399-6101 長野県木管 都日義村5029 Nagano (JP). 復置方記 (TOKUTAKE, Yoshiki) [JP/JP]; 〒399-8201 長野県南安養郡穂高町大字柏原1591-2 フォーレス安ע野C101 Nagano (JP). 伊 佐治正幸 (ISAJI, Masayuki) [JP/JP]; 〒399-0704 長野 區據民市広丘總原1763-189 Nagano (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID. IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN. YU, ZA. ZW.

(84) 指定国 (広城): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, VI) LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書籍: 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: GLUCOPYRANOSYLOXY BENZYLBENZENE DERIVATIVES, MEDICINAL COMPOSITIONS CONTAINING THE SAME AND INTERMEDIATES FOR THE PREPARATION OF THE DERIVATIVES

(54) 発明の名称: グルコピラノシルオキシベンジルベンゼン誘導体、それを含有する医薬組成物およびその製造中 版体

for the preparation of the derivatives wherein R1 is hydrogen or hydroxylated lower alkyl; R2 is lower alkyl, lower alkoxy, lower alkylthio, hydroxylated lower alkyl, hydroxylated lower alkoxy, hydroxylated lower alkylthio, or the like.

/統策有7